

ナノ・キャラクタリゼーション専門部会 第2回研究会

(一般社団法人) 日本真空学会 機能薄膜部会

テーマ：薄膜の物性評価の実際

機能性薄膜を評価するにおいては、その機能性の他に使用環境における化学的・力学的耐久性が求められています。また、近年の機能性薄膜は微細化が進み評価方法も高度化を求められており、ナノインデンテーション技術はその評価の一部を担っています。

今回は、ナノインデンテーションの生みの親である Warren C. Oliver 博士をお招きし、さらに実際に評価を行っている下記2名の講師の方々よりご講演をお願いしております。

主催：(一般社団法人) 日本真空学会 機能薄膜部会

ナノ・キャラクタリゼーション専門部会

日時：平成25年10月16日(水) 13:30～

会場：東陽テクニカ テクノロジーインターフェースセンター

<プログラム>

13:30-14:40 第1部 ナノインデンテーションの応用(仮)

(Nanomechanics, Inc. Warren C. Oliver)

(14:40-15:00:休憩)

15:00-15:30 第2部 現在・今後の取り組み(仮)

(Nanomechanics, Inc. Warren C. Oliver)

15:30-16:00 ナノメカニカル計測評価の現状と今後の方向性

(株式会社 日産アーク 児嶋 伸夫)

16:00-16:30 ナノスクラッチ法による高分子二層膜からなる固/固界面の力学特性評価

(株式会社 豊田中央研究所 古賀 智之)

16:30-17:00 総括

(物質・材料研究機構 吉原 一紘)

17:00-19:00 《交流会》

参加費+テキスト代：

機能薄膜部会委員：無料、真空学会会員1,000円、学生：無料、その他：2,000円

申し込み先：

一般社団法人 日本真空学会 事務局

TEL 03-3431-4395 FAX 03-3433-5371 URL <http://www.vacuum-jp.org>

メール e-mail：ofc-vs.j@vacuum-jp.org で申してください。

問い合わせ先：

大川 登志郎

オミクロンテクノロジージャパン株式会社

〒144-0052 大田区蒲田 5-30-15

TEL : 03-6661-0850 e-mail : t.okawa@omicron.oxinst.com

会場案内：

東陽テクニカ テクノロジーインターフェースセンター

<http://www.toyo.co.jp/company/access.html#honsya>

[地下鉄] 銀座線／東西線： 日本橋駅 A1出口から徒歩5分 銀座線／半蔵門線： 三越前駅

B3出口（半蔵門線のみ）から徒歩1分/B5出口から徒歩5分

[JR]東京駅 八重洲北口 徒歩7分

